A Elipsometria é uma técnica utilizada amplamente em pesquisa e na indústria para a caracterização de filmes finos. Entretanto, esta técnica por vezes apresenta múltiplas soluções para a curva de dispersão e espessura física dos filmes, dificultando sua caracterização acurada. Em vista disto, neste trabalho desenvolvemos uma técnica de medida polarimétrica baseada na Técnica de Abelès. Esta técnica, ao contrário de outras técnicas ópticas (Elipsometria, Modos Guiados e Curvas Envoltórias), utiliza o ângulo de Brewster para determinar o índice de refração de filmes independentemente de suas espessuras físicas. A técnica obtém o índice através de uma medida comparativa entre refletâncias de luz polarizada (polarização p): a luz refletida pelo conjunto filme-substrato é comparada com a luz refletida pelo substrato apenas. O casamento de refletâncias pode ocorrer em situações de absent layer devido à interferência da luz ou na condição de Brewster. Entretanto como esta condição só ocorre na polarização p e as situações de absent layer ocorrem para qualquer polarização da luz, o ângulo de Brewster é facilmente identificado e o índice de refração do filme pode ser calculado. A curva de dispersão obtida pela técnica polarimétrica é então utilizada como aproximação inicial no modelo de cálculo das constantes ópticas do filme usado no software de análise do Elipsômetro Espectral, permitindo que soluções falsas sejam descartadas. Além disso, a técnica polarimétrica não necessita de outra montagem experimental, já que ela é realizada utilizando-se também o Elipsômetro. As medidas são realizadas na mesma posição na amostra, aumentando assim a confiabilidade dos resultados obtidos. Um conjunto de filmes de TiO₂ foi utilizado para demonstrar a viabilidade da técnica na exclusão de falsas soluções, obtendo a correta caracterização das suas constantes ópticas. Concluindo, este trabalho foi publicado: PEREIRA, M.; BARRETO, B.; HOROWITZ, F. Spectral polarimetry technique as a complementary tool to ellipsometry of dielectric films. Applied Optics v. 50, p. C420-C423, 2011.